

# № XXII.C.176 - 1 стр

**Издательство:**  
**КАИ КОЗЛОВ**  
Александр Иванович

Бортовая аппаратура космических систем Д33

ISBN: 978-5-6052833-0-0

## Формирование краев кристаллов субмодулей для мозаичных, беззазорных фотоприемников. Обзор

**Козлов<sup>1</sup> А. И.,** Новоселов А. Р.

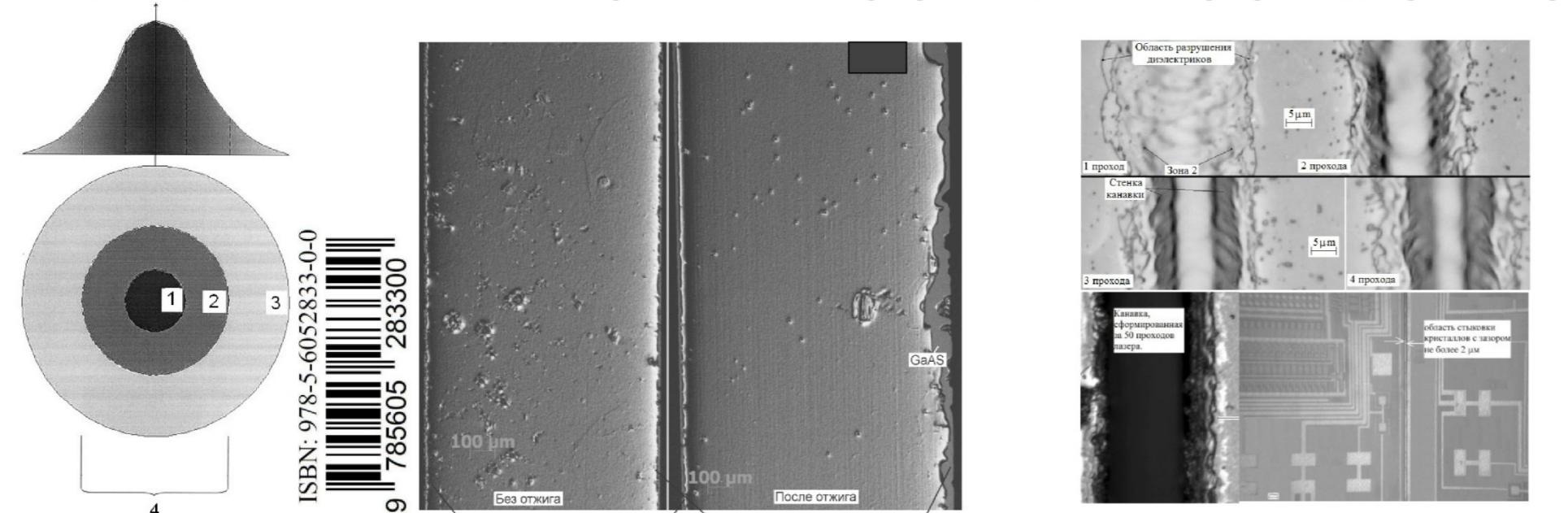
КТИ ПМ СО РАН, ИФП СО РАН, 630084, г. Новосибирск, Российской Федерации. Электронная почта докладчика и ответственного за переписку с оргкомитетом 1/e-mail: aikozlov13@mail.ru

**Ключевые слова:** мозаичная технология, мозаичный фотоприёмник [МФП] с предельной эффективностью преобразования изображений, "слепая зона", фоточувствительный элемент (ФЧЭ), сверхвысокая размерность

**Введение** Потеря части информации в изображении является недостатком мозаичных фотоприёмников (МФП), что связано с зазорами между смежными кристаллами и зонами повреждения материала на их краях, возникающими при разрезании приборных пластин [1-8]. В докладе представлены результаты исследований по определению подходов к формированию краёв кристаллов для беззазорных МФП. Результат – достигнутое расстояние между краевыми фоточувствительными элементами (ФЧЭ) в МФП на основе КРТ – 22 мкм, для кремниевых кристаллов расстояние не превышает 17 мкм.

Исследования направлены на формирование определенного распределения плотности энергии на поверхности полупроводникового материала, способа формирования канавки и выбора способа откола края кристалла [1-8].

**Формирование определенного распределения плотности энергии на поверхности полупроводникового материала** – нанесение фоторезиста на поверхность приборной пластины. На краях пятна излучения существует колцевая область, плотности излучения которой недостаточно для плавления материала, но разными авторами регистрируются изменения свойств материала. Нанесение фоторезиста на поверхность приборной пластины отсекает это излучение. Токи, протекающие через p-n-переходы в пленках для разных расстояний до канавки, демонстрируют некоторую область разброса токов по кристаллу при рабочих смещениях. Безопасное расстояние от 8 мкм с фоторезистом до 13 мкм – без фоторезиста, для кремниевых кристаллов ~5 мкм [1, 6-8].



Технология создания МФП сверхвысокой размерности модернизирована с целью устранения "слепых зон" (рис. 1), [1, 6-8]. Зазор между кристаллами смежных субмодулей МФП составляет не более 2-3 мкм. Развитие методологии лазерного разделения пластин в составе мозаичной технологии позволило уменьшить технологические "слепые зоны" МФП до 11-19 мкм для различных определяющих полупроводниковых материалов [1-7]. При применении указанного прецизионного формирования стыкуемых граней кристаллов с обеспечением минимальной (5 - 8 мкм) области повреждения расстояние между ФЧЭ смежных субмодулей составит 10-12 мкм, что соответствует потере одного элемента с шагом 10 мкм в каждой строке и столбце [2-7]. В случае других материалов расстояние между краевыми ФЧЭ смежных субмодулей составит также около 10-12 мкм для МСКЯ-фотодетекторов на основе GaAs/AlGaAs и порядка 16-19 мкм для КРТ-фотодиодов, что соответствует потере 1-2 элементов в каждой строке и столбце [2-7]. В работе исследованы фундаментальные основы создания МФП сверхвысокой размерности.

**Способ формирования канавки** Лазерное скрайбирование края кристалла с длиной волны 0,337 мкм в многопроходном режиме с площадью перекрытия световых пятен ~90% (120 мкм/сек.), углом наклона оптической оси излучения 12° к нормали поверхности. При таком способе плоскость стенки канавки со стороны кристалла имеет небольшое отклонение от нормали к поверхности, глубина канавки ~100 мкм, расплав материала на поверхности отсутствует. После разделения приборной пластины потребуется процесс формирования края кристалла, закрытого фоторезистом [1, 6-8].

ISBN: 978-5-6052833-0-0

1

ISBN: 978-5-6052833-0-0

ISBN: 978-5-6052833-0-0

**Козлов А.И., Новоселов А.Р.** Формирование краев кристаллов субмодулей для мозаичных, беззазорных фотоприемников. Обзор. Книга-плакат. Научная монография. – Новосибирск. Изд.: "Козлов Александр Иванович". 2024. 4 с., ил.

